

分析結果報告書〔6〕1/3

1. 6 模擬排水試料（ほう素及びその化合物）

機関コード	
機関名	
電話番号	
国際的な認証等の取得（複数回答可）	1. ISO 9001～9003 2. ISO/IEC 17025(ガイド25) 3. MLAP 4. (上記1～3を取得していないが)品質マネジメントシステム(QMS)を構築している
分析主担当者 氏名	()
経験年数(年)	()年
実績(年間の分析試料数)	()
分析(主)担当者以外の分析結果の確認	1. あり 2. なし

<分析結果>

1回目(mg/L) 注1～4)	() mg/L
2回目(mg/L) 注1～4)	() mg/L
3回目(mg/L) 注1～4)	() mg/L
Z-スコアの報告書資料編への記載 注5)	1. 希望する 2. 希望しない

注1) 本調査においては、下限値を指定せず、各機関の検出下限値以上のデータを報告値とする。

注2) 検出下限値以上であった場合、JIS Z 8401 によって数値を丸めて有効数字3桁で報告値を記入する。

注3) 検出下限値未満であった場合、NDと記入するとともに、その後ろに検出下限値を括弧()をつけ JIS Z 8401 によって数値を丸めて有効数字1桁で記入する。

注4) 共通試料1-2を水で10倍希釈して調製した分析用試料中の濃度(mg/L)を記入する。

注5) 分析結果を報告した機関が20に満たない際は、Z-スコアの報告書資料編への記載を行わない場合がある。

<分析方法等>

試料受取日	()
分析開始までの試料保存日数(日)	()日
分析日数(日)	()日
分析方法	1. メチレンブルー吸光光度法 2. アゾメチンH吸光光度法 3. ICP 発光分光分析法 4. ICP 質量分析法 5. その他()
使用した水	1. 蒸留水 2. イオン交換水 3. 超純水 4. その他()

<メチレンブルー吸光光度法>

試料分取量(mL) 注)	()mL
炭酸ナトリウムを加えて蒸発乾固・融解	1. 行う 2. 行わない
定容量(mL)	1. 15 mL 2. その他() mL
1,2-ジクロロエタン抽出液量(mL)	1. 10 mL 2. その他() mL
測定波長(nm)	1. 660nm 2. その他()nm

注) 10倍希釈後の試料を分析に使用した量を記入する。

<アゾメチンH吸光光度法>

試料分取量(mL) 注)	()mL
定容量(mL)	1. 25 mL 2. その他() mL
反応時間(時間)	1. 2時間 2. その他()時間
測定波長(nm)	1. 410nm 2. その他()nm

注) 10倍希釈後の試料を分析に使用した量を記入する。

分析結果報告書〔6〕 2/3

<ICP 発光分光分析法>

ろ過等の操作	1. 行わない 2. ろ過 3. 遠心分離 4. その他()
試料の希釈倍率 注)	()
ICP 発光分光分析装置 メーカー	1. アジレント 2. サーモサイエンティフィック 3. 島津製作所 4. パーキンエルマー 5. 日立ハイテク 6. その他()
型式	()
ICP 発光分光分析装置 発光部(光観測方式) 分光部	1. 横方向 2. 軸方向 3. その他() 1. ツェルニ・ターナー型(シーケンシャル形) 2. パッシェン・ルンゲ型(同時測定形) 3. エシエル型(同時測定形) 4. その他()
検出部	1. 光電子増倍管(フォトマル) 2. 半導体検出器 3. その他()
バックグラウンド補正	1. 行う 2. 行わない
測定波長(nm)	1. 249.773 nm 2. 249.677 nm 3. 208.959 nm 4. 208.893 nm 5. その他()nm
装置メモリー低減対策の実施状況 (バックグラウンド低減対策) 低減方法	1. 行う 2. 行わない 1. 酸による洗浄 2. 超純水による洗浄 3. 酸と超純水による洗浄 4. その他の方法()
内標準物質	1. イットリウム 2. インジウム 3. イッテルビウム 4. その他() 5. 使用しない
内標準物質添加量(μg)	() μg

注) 10倍希釈後の試料をさらに希釈した場合に記入する。希釈しない場合には、希釈倍率を「1」とする。

<ICP 質量分析法>

ろ過等の操作	1. 行わない 2. ろ過 3. 遠心分離 4. その他()
試験溶液の希釈倍率 注)	()
ICP 質量分析計 メーカー	1. アジレント 2. サーモフィッシャー 3. 島津製作所 4. パーキンエルマー 5. その他()
型式	型式()
スペクトル干渉の低減又は補正 質量分析計 コリジョン・リアクションセル	1. 四重極 2. その他() 1. 行わない 2. 行う
「2. 行う」場合の使用ガスの種類	1. ヘリウム 2. 水素 3. ヘリウム・水素混合ガス 4. メタン 5. その他()
「2. 行う」場合の使用ガスの流量	()mL/分
補正式による補正	1. 行わない 2. 行う(その方法の概要:)
その他	1. 行わない 2. 行う()
超音波ネブライザーの使用	1. 使用しない 2. 使用する
スプレーチャンバーの材質	1. 石英 2. ガラス 3. 樹脂 4. その他()
積分時間(質量数毎)(秒)	()秒
装置メモリー低減対策の実施状況 (バックグラウンド低減対策) 低減方法	1. 行う 2. 行わない 1. 酸による洗浄 2. 超純水による洗浄 3. 酸と超純水による洗浄 4. その他の方法()
質量数	1. 11 2. 10 3. その他()
内標準物質	1. ベリリウム 2. イットリウム 3. インジウム 4. その他() 5. 使用しない
内標準物質添加量(μg)	() μg

注) 10倍希釈後の試料をさらに希釈した場合に記入する。希釈しない場合には、希釈倍率を「1」とする。

<標準液>

標準液メーカー名	()
使用時の濃度保証	1. 保証期間内 2. 保証期間超過
ファクター	()
Lot番号	()

<定量方法・下限値>

定量方法	1. 絶対検量線法 2. 標準添加法 3. 内標準法
検出下限値(mg/L)	()mg/L 注)

注) 試料中の濃度(mg/L)を示す。

分析結果報告書〔6〕 3/3

<試料の保存状況>

保存方法	1. 冷暗所保存 3. その他 ()	2. 保存しない (直ちに分析)
試料の保存処理	1. 行った その方法 ()	2. 行っていない
保存温度 (°C)	約()°C	

分析実施にあたっての留意した点及び問題と感じた点	
--------------------------	--

計算式	
-----	--

<検量線>

単位		1. $\mu\text{g/mL}$ 2. μg 3. その他 ()		
検量線		ほう素		内標準物質 注2)
		ほう素量または濃度 注1)	応答値	内標準物質または 濃度
検量線標準液 (1を最低濃度とし、番号順に高濃度とする)	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
空試験 注3)		—		
共通試料1回目 注4)		—		
共通試料2回目 注4)		—		
共通試料3回目 注4)		—		

- 注1) 検量線標準液の濃度を記入する。
 注2) 内標準物質を使用していない場合は空欄とする。
 注3) 標準添加法では記入しない。
 注4) 標準添加法では添加のない試料の値を示す